Rec'd PCT/PTO 13 SEP 2004

特許協力条約



PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70] RECEIVED

1 8 MAR 2004

WIPÓ PCT

10/507484

出願人又は代理人 の書類記号 PCT0302ND	「			
国際出願番号 PCT/JP03/02890	国際出願日 12.03.03	優先日 (日.月.年) 15.03.02		
国際特許分類(IPC)	Int. Cl' G02B1/10			
出願人(氏名又は名称)	日東電工株式会社	·		
2. この国際予備審査報告は、この表記 × この国際予備審査報告には、	む明細書、請求の範囲及び/又は図面も額	-ジからなる。 ・ ウ基礎とされた及び/又はこの国際予備審		
この附属書類は、全部で	2ページである。			
 I 図 国際予備審査報告の基礎 Ⅲ				
国際予備審査の舘求告を受理した日	国際予備審査報告	を作成した日		
16.07.2003		01. 03. 2004		
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP 郵便番号100-8915 東京都千代田区領が関三丁目4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	限のある職員) 2 V 3 0 1 2 系 竜介 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 2 7 1		



国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/02890

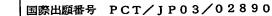
I. 国際予備審査報告の基礎				
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)				
出願時の国際出願書類				
× 明細書 第 1-32 ページ、 明細書 第 ページ、 明細書 第 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求暋と共に提出されたもの ———— 付の書簡と共に提出されたもの			
※ 請求の範囲 第 8-10、15 項、 請求の範囲 第 1、3-7、11-13 項、 請求の範囲 第 項、 請求の範囲 第 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 30.10.03 付の書簡と共に提出されたもの			
X 図面 第 1-4 ページ/図、 図面 第 ページ/図、 図面 第 ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの			
明細書の配列表の部分 第ページ、明細書の配列表の部分 第ページ、明細書の配列表の部分 第ページ、明細書の配列表の部分 第ページ、	出題時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			
2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、こ	の国際出願の言語である。			
上記の書類は、下記の言語である 語であ	აგ.			
国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語				
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。				
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。				
4. 補正により、下記の書類が削除された。 明細書 第 × 請求の範囲 第 図面 図面の第	ージ/図			
5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)				



国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/02890

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性 文献及び説明	についての法第12条(PC	CT35条(2)) に定める見解、それ	ルを裏付ける
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1, 3-15 None	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	None 1, 3-15	有 無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1, 3-15 None	有 無
2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)			
文献1: JP 2002-616 2002. 01. 09 & US 2002/ 文献2: JP 59-5260 1983. 03. 28 文献3: JP 63-2160 1988. 01. 29 文献4: US 4904525 1990. 02. 27 & JP 64-15 文献5: JP 2000-47 2000. 02. 18 文献6: US 6008940 1999. 12. 28 & JP 9-251	0034008 A 1 A (株式会社諏 1 A (東レ株式会社 A (Toray Industr 27 A 005 A (帝人株:	1 訪精工舎) 社) ries, Inc.,) 式会社)	
請求の範囲1、3、4 請求の範囲1、3、4に記載 請求の範囲1、3、4に記載 い。文献1には、フッ職される を含む反射防止膜が記載での の屈折率が1.49以ので、 のにも明のことである、 でれぞれ。 でもいる ではいる ではいる ではいる ではいる ではいる ではいる ではいる では	料を主成分とする頃いる(【0032】 ことは、文献6に記載らに記載された現 に記載された発明の 素含有材料領域との 自明のことである。	吸中にシリカ俶祉子から ー【0042】)。、シリ 載されているように、当 ッ素含有材料、シリカ微 二種類の低屈折材料に相 リカ微粒子領域が、海島 文献1には、シリカ微粒	なか なか 微者 とい とい も は も は も は も は も は る は る 。 は る 。 は る 。 も に は る 。 も に も る も に も ら も ら に も ら ら も ら も ら も ら も ら も ら も ら も ら も ら も ら も ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら
請求の範囲5 請求の範囲5に記載された発 5には、フッ素含有材料を主成 領域によって形成された反射防 5】)。文献5に記載されたフ 折率が1.49以下であること 者にとって自明のことである。 リシロキサン構造を主成分とす	分とする領域中にボ 止膜が記載されてい ッ素含有材料、ポリ は、それぞれ文献1 文献5には、フッ素	(リシロキサン構造を王成る(【0012】-【0 シロキサン構造を有する 、2に記載されているよ 含有材料を主成分とする	分とする 01 材料の屈 領域、ポ





補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 閥の続き

(【0006】、【0015】、【図2】)。

請求の範囲6-13 請求の範囲6-13に記載された発明は、文献1、2、5、6により進歩性を有しない。反射防止層を、ハードコート層を介して設けることは、文献1、5に記載されている。反射防止層が、凹凸形状により防眩性を有すること、分散された微粒子により凹凸形状表面が形成されたハードコート層を介して設けられること、偏光板の保護フィルムとして設けられることは文献1に記載されている。

請求の範囲14、15 請求の範囲14、15に記載された発明は、文献1、2、3、5により進歩性を有 しない。文献5には、二種類の低屈折率材料を溶媒に溶解した塗工液を塗工して、異 なる領域を形成した分離構造の反射防止膜を得ることが記載されている。文献5に記 載された二種類の低屈折率材料の屈折率が1.49以下であることは、文献1、2に 記載されているように当業者にとって自明のことである。溶媒としてケトン系溶媒、 アルコール系溶媒は文献3に記載されているように、当業者にとって自明のものであ る。

請求の範囲

1. (補正後)透明基材フィルムの少なくとも片面に、直接または別の層を介して、反射防止層が形成されている反射防止フィルムにおいて、

前記反射防止層が、屈折率: n a ²⁰ ≤ 1. 4 9 を満足する、少なくとも二種類の低屈折率材料によって形成されており、かつ、異なる領域を形成した分離構造になっていることを特徴とする反射防止フィルム。

- 2. (削除)
- 3. (補正後)分離構造が、海島構造になっていることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の反射防止フィルム。
- 4. (補正後)分離構造における、短領域のサイズが5~1000nmの範囲であることを特徴とする請求の範囲第1項または第3項に記載の反射防止フィルム
- 5. (補正後) 反射防止層が、フッ素含有材料を主成分とする領域とポリシロキサン構造を主成分とする領域によって形成されていることを特徴とする請求の範囲第1項、第3項または第4項に記載の反射防止フィルム。
- 6. (補正後) 反射防止層が、ハードコート層を介して設けられていることを特徴とする請求の範囲第1項、第3項~第5項のいずれかに記載の反射防止フィルム。
- 7. (補正後) 反射防止層が、凹凸形状になっており、防眩性を有することを特徴とする請求の範囲第1項、第3項~第5項のいずれかに記載の反射防止フィルム。
- 8. 反射防止層が、微粒子が分散され、かつ当該微粒子により凹凸形状表面が形成されたハードコート層を介して設けられていることを特徴とする請求の範囲第7項に記載の反射防止フィルム。
- 9. 反射防止層の表面の60°光沢度が20~120%であることを特徴とする請求の範囲第7項または第8項に記載の反射防止フィルム。
- 10. ヘイズ値が、10~60%であることを特徴とする請求の範囲第7項~第9項のいずれかに記載の反射防止フィルム。

- 11. 偏光子の片面又は両面に、請求の範囲第1項、第3項~第10項のいずれかに記載の反射防止フィルムの透明基材フィルムが保護フィルムとして設けられていることを特徴とする偏光板。
- 12. 請求の範囲第1項、第3項~第10項のいずれかに記載の反射防止フィルムまたは請求の範囲第11項に記載の偏光板を用いていることを特徴とする光学素子。
- 13. 請求の範囲第1項、第3項~第10項のいずれかに記載の反射防止フィルム、請求の範囲第11項に記載の偏光板、または請求の範囲第12項に記載の光学素子を用いていることを特徴とする画像表示装置。
- 14. (補正後)透明基材フィルムの少なくとも片面に、直接または別の層を介して、反射防止層を形成する反射防止フィルムの製造方法において、

前記反射防止層の形成を、屈折率: n_d ²⁰ ≤ 1. 49 を満足する、少なくとも 二種類の低屈折率材料を溶媒に溶解した塗工液を、塗工後、乾燥することにより 行い、異なる領域を形成した分離構造の反射防止層を形成すること特徴とする反 射防止フィルムの製造方法。

15. 低屈折率材料が、フッ素含有材料とポリシロキサン形成材料を含み、溶媒が、ケトン系溶媒とアルコール系溶媒を含む混合溶媒であることを特徴とする請求の範囲第14項に記載の反射防止フィルムの製造方法。